

**METHOD OF PRODUCING GALLIUM NITRIDE BASED COMPOUND SEMICONDUCTOR**

Patent Number: JP2000091253  
Publication date: 2000-03-31  
Inventor(s): KOIDE NORIKATSU  
Applicant(s):: TOYODA GOSEI CO LTD  
Requested Patent: ☐ JP2000091253 (JP00091253)  
Application Number: JP19990289870 19971107  
Priority Number(s):  
IPC Classification: H01L21/205 ; H01L21/20 ; H01L33/00 ; H01S5/323  
EC Classification:  
Equivalents:

**Abstract**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To form a semiconductor layer without crack and dislocation by etching in the shape of an island with a dot-shape, a stripe-shape or a grid-shape and laterally growing a second gallium nitride based compound semiconductor on an exposed surface of a substrate using an island-shaped first gallium nitride based compound semiconductor as core.

**SOLUTION:** An SiO<sub>2</sub> layer is etched in a specified form by photolithography. Next an Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>N layer 2 is dry-etched using the SiO<sub>2</sub> layer with the specified shape as mask. A GaN layer 3 is epitaxially grown on a substrate 1 by MOVPE method. At that time, the GaN layer 3 is epitaxially grown on an Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>N layer 2 using the Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>N layer 2 as core. But the GaN layer dose not epitaxially grow on an exposed region A of a silicon substrate 1. The GaN is epitaxially grown on the exposed region A of the silicon substrate 1 in the direction of the surface of the silicon substrate 1 using the GaN grown on the Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>N layer 2 as core.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-91253  
(P2000-91253A)

(43) 公開日 平成12年3月31日 (2000.3.31)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
H 0 1 L 21/205		H 0 1 L 21/205	
21/20		21/20	
33/00		33/00	C
H 0 1 S 5/323		H 0 1 S 5/323	
// H 0 1 L 31/10		H 0 1 L 31/10	A
審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 5 頁)			

(21) 出願番号 特願平11-289870  
(62) 分割の表示 特願平9-322132の分割  
(22) 出願日 平成9年11月7日 (1997. 11. 7)

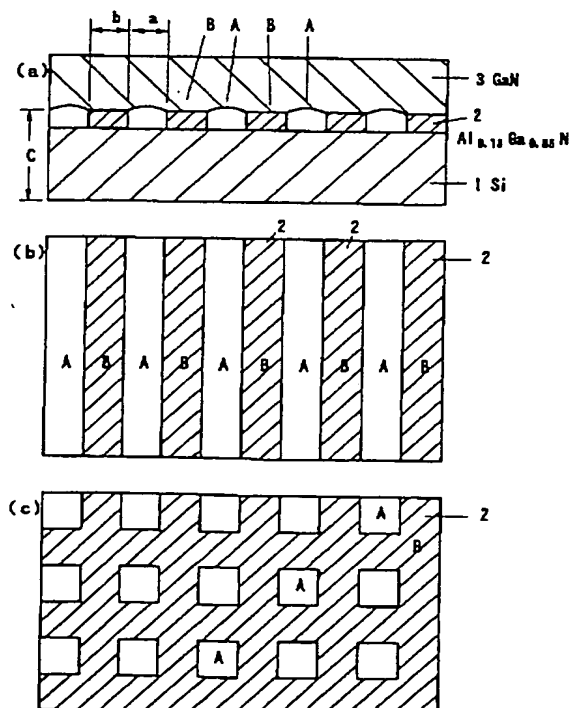
(71) 出願人 000241463  
豊田合成株式会社  
愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑 1  
番地  
(72) 発明者 小出 典克  
愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑 1  
番地 豊田合成株式会社内  
(74) 代理人 100087723  
弁理士 藤谷 修

(54) 【発明の名称】 窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法

(57) 【要約】

【課題】素子特性及び製造効率を向上させること。

【解決手段】シリコン基板 1 の上にはストライプ状又は格子状に  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層 2 が形成されている。基板 1 の露出領域 A と層 2 の上部領域 B に、GaN 層 3 を成長させる。このとき、GaN は、層 2 の  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  上に 3 次元的（垂直方向のみならず横方向にも）にエピタキシャル成長する。このように、GaN が横方向にもエピタキシャル成長するので、基板 1 の露出領域 A である横方向成長領域では転位が大幅に減少した窒化ガリウム系化合物半導体を得ることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に第1の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、その後、その第1の窒化ガリウム系化合物半導体を、前記基板の露出部が散在するように、点状、ストライプ状又は格子状等の島状態にエッチングし、その後、前記島状態の前記第1の窒化ガリウム系化合物半導体を核として成長するが、前記基板の露出部を核としてはエピタキシャル成長しない第2の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、前記基板の露出面上は横方向成長により形成し、

前記第2の窒化ガリウム系化合物半導体の上に窒化ガリウム系化合物半導体から成る素子層を形成することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。

【請求項2】基板上にバッファ層を形成し、そのバッファ層の上に第1の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、その後、バッファ層及び第1の窒化ガリウム系化合物半導体を、前記基板の露出部が散在するように、点状、ストライプ状又は格子状等の島状態にエッチングし、その後、前記島状態の前記第1の窒化ガリウム系化合物半導体を核として成長するが、前記基板の露出部を核としてはエピタキシャル成長しない第2の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、前記基板の露出面上は横方向成長により形成することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。

【請求項3】前記基板はサファイア、シリコン、又は、炭化珪素であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。

【請求項4】前記バッファ層は、任意組成比の $\text{AlGaIn}$ 、任意組成比の $\text{AlGaInN}$ であること特徴とする請求項2又は請求項3に記載の窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。

【請求項5】前記第1の窒化ガリウム系化合物半導体と前記第2の窒化ガリウム系化合物半導体とは同一組成比であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。

【請求項6】前記第1の窒化ガリウム系化合物半導体の厚さは $500\text{Å} \sim 2000\text{Å}$ であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。

【請求項7】前記露出部はエッチングして残された前記第1の窒化ガリウム系化合物半導体よりも広いことを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、一般式 $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_{1-x-y}\text{N}$  ( $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x+y \leq 1$ )の窒化ガリウム系化合物半導体とその製造方法に関する。特に、基板上に横方向エピタキシャル成長 (ELO) を用いた方

法に関する。

##### 【0002】

【従来の技術】窒化ガリウム系化合物半導体は、発光スペクトルが紫外から赤色の広範囲に渡る直接遷移型の半導体であり、発光ダイオード(LED) やレーザダイオード(LD)等の発光素子に応用されている。この窒化ガリウム系化合物半導体では、通常、サファイア上に形成している。

##### 【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来技術では、サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体を形成すると、サファイアと窒化ガリウム系化合物半導体との熱膨張係数差により、半導体層にクラック、そりが発生し、ミスフィットにより転位が発生し、このため素子特性が良くないという問題がある。

【0004】従って、本発明の目的は、上記課題に鑑み、クラック、転位のない窒化ガリウム系半導体層を形成することで、素子特性を向上させると共に、効率のよい製造方法を実現することである。

##### 【0005】

【課題を解決するための手段及び作用効果】上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、基板上に第1の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、その後、その第1の窒化ガリウム系化合物半導体を、前記基板の露出部が散在するように、点状、ストライプ状又は格子状等の島状態にエッチングし、その後、島状態の第1の窒化ガリウム系化合物半導体を核として成長するが、基板の露出部を核としてはエピタキシャル成長しない第2の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、基板の露出面上は横方向成長により形成し、第2の窒化ガリウム系化合物半導体の上に窒化ガリウム系化合物半導体から成る素子層を形成することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法である。

【0006】尚、ここでいう横方向とは、基板の面方向を意味する。これにより、第2の窒化ガリウム系化合物半導体は、基板の露出部には成長せず、第1の窒化ガリウム系化合物半導体上に3次元的、即、面方向にも成長し、基板の上方向では一様に成長される。この結果、基板と窒化ガリウム系化合物半導体との間のミスフィットに基づく転位は縦方向に成長し、横方向へは成長しない。よって、基板の露出部上の第2の窒化ガリウム系化合物半導体の縦方向の貫通転位はなくなり、第1の窒化ガリウム系化合物半導体の上の部分だけ縦方向の貫通転位が残る。この結果、第2の窒化ガリウム系化合物半導体の縦方向の貫通転位の面密度が極めて減少する。従って、第2の窒化ガリウム系化合物半導体の結晶性が向上する。また、基板の露出部とその上の第2の窒化ガリウム系化合物半導体とは化学的に接合していないので、第2の窒化ガリウム系化合物半導体のそりが防止されると共に応力歪みとその半導体に入ることが抑制される。

【0007】請求項2の発明は、基板上にバッファ層を形成し、そのバッファ層の上に第1の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、その後、バッファ層及び第1の窒化ガリウム系化合物半導体を、基板の露出部が散在するように、点状、ストライプ状又は格子状等の島状態にエッチングし、その後、島状態の第1の窒化ガリウム系化合物半導体を核として成長するが、基板の露出部を核としてはエピタキシャル成長しない第2の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、基板の露出面は横方向成長により形成することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法である。

【0008】請求項3の発明は、基板はサファイア、シリコン、又は、炭化珪素であることを特徴とする。請求項4の発明は、バッファ層は、任意組成比の $\text{AlGaIn}$ 、任意組成比の $\text{AlGaInN}$ であること特徴とする。請求項5の発明は、第1の窒化ガリウム系化合物半導体と第2の窒化ガリウム系化合物半導体とは同一組成比であることを特徴とする。請求項6の発明は、第1の窒化ガリウム系化合物半導体の厚さは $500\text{Å} \sim 2000\text{Å}$ であることを特徴とする。請求項7の発明は、露出部はエッチングして残された前記第1の窒化ガリウム系化合物半導体よりも広いことを特徴とする。

【0009】上記の発明において、基板には、サファイア、シリコン、又は、炭化珪素を用いることができる。それらの基板上で得られる第2の窒化ガリウム系化合物半導体の結晶性を向上させることができる。

【0010】上記の発明において、基板をシリコン、島状態に形成される第1の窒化ガリウム系化合物半導体をアルミニウムを含む窒化ガリウム系化合物半導体、第2の窒化ガリウム系化合物半導体をアルミニウムを含まない窒化ガリウム系化合物半導体とすることも可能である。この場合には、アルミニウムを含む窒化ガリウム系化合物半導体はシリコン上にエピタキシャル成長するが、アルミニウムを含まない窒化ガリウム系化合物半導体はシリコン上にエピタキシャル成長しない。よって、シリコン基板上に島状態の第1の窒化ガリウム系化合物半導体を形成し、その後、その第1の窒化ガリウム系化合物半導体上にはエピタキシャル成長するが、シリコン基板の露出部にはエピタキシャル成長しない第2の窒化ガリウム系化合物半導体を形成することができる。これにより、シリコン基板の露出部上は、第1の窒化ガリウム系化合物半導体を核として、第2の窒化ガリウム系化合物半導体が横方向にエピタキシャル成長することになり、結晶性の高い窒化ガリウム系化合物半導体を得ることができる。

【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明する。

（第1実施例）図1は、本発明の第1実施例に係わる窒化ガリウム系化合物半導体の断面構成を示した模式図で

ある。シリコン基板1の上には膜厚約 $1000\text{Å}$ の $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ 層（第1の窒化ガリウム系化合物半導体）2がストライプ状（図1（b））又は格子状（図1（c））に形成されている。又、シリコン基板1上の層2を除いた露出領域A及び層2の上面領域Bには膜厚約 $10\mu\text{m}$ の $\text{GaN}$ 層（第2の窒化ガリウム系化合物半導体）3が形成されている。

【0012】次に、この $\text{GaN}$ 系化合物半導体の製造方法について説明する。この半導体は、スパッタリング法及び有機金属気相成長法（以下「MOVPE」と略す）により製造された。MOVPEで用いられたガスは、アンモニア（ $\text{NH}_3$ ）、キャリアガス（ $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ ）、トリメチルガリウム（ $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$ ）（以下「TMG」と記す）、トリメチルアルミニウム（ $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ ）（以下「TMA」と記す）である。

【0013】まず、フッ酸系溶液（ $\text{HF}:\text{H}_2\text{O}=1:1$ ）を用いて洗浄した（111）面、（100）面、又は、（110）面を主面とした $n$ -シリコン基板1をMOVPE装置の反応室に設置されたサセプタに装着する。次に、常圧で $\text{H}_2$ を流速2 liter/分で約10分間反応室に流しながら温度 $1150^\circ\text{C}$ で基板1をベーキングした。

【0014】この後、基板1の温度を $1150^\circ\text{C}$ に保持し、 $\text{N}_2$ 又は $\text{H}_2$ を10 liter/分、 $\text{NH}_3$ を10 liter/分、TMGを $1.0 \times 10^{-4}$ モル/分、トリメチルアルミニウム（ $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ ）（以下「TMA」と記す）を $1.0 \times 10^{-5}$ モル/分、 $\text{H}_2$ ガスにより0.86ppmに希釈されたシランを $20 \times 10^{-8}$ モル/分で供給し、膜厚約 $1000\text{Å}$ 、Si濃度 $1.0 \times 10^{18}/\text{cm}^3$ の $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ 層2を形成した。

【0015】次に、この層2の上に、一様に、 $\text{SiO}_2$ 層をスパッタリングにより膜厚約 $2000\text{Å}$ に形成し、レジストを塗布して、フォトリソグラフィにより $\text{SiO}_2$ 層を所定形状にエッチングした。次に、この所定形状の $\text{SiO}_2$ 層をマスクとして、 $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ 層2をドライエッチングした。このようにして、層2の上部領域Bの幅 $b$ が約 $5\mu\text{m}$ 、基板1の露出領域Aの間隔 $a$ が約 $5\mu\text{m}$ のストライプ状（図1（b））又は格子状（図1（c））に形成した。

【0016】次に、MOVPE法により基板1の温度を $1100^\circ\text{C}$ にして $\text{N}_2$ 又は $\text{H}_2$ を20 liter/分、 $\text{NH}_3$ を10 liter/分、TMGを $1.0 \times 10^{-4}$ モル/分、 $\text{H}_2$ ガスにより0.86ppmに希釈されたシランを $20 \times 10^{-8}$ モル/分で供給して、膜厚約 $10\mu\text{m}$ の $\text{GaN}$ 層3をエピタキシャル成長させた。このとき、 $\text{GaN}$ は、 $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ 層2の上に、この $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ を核として、エピタキシャル成長する。しかし、シリコン基板1の露出領域Aの上には、 $\text{GaN}$ はエピタキシャル成長しない。そして、シリコン基板1の露出領域Aでは、 $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ 層2上に成長した $\text{GaN}$ を核として、 $\text{GaN}$ が横方向、即ち、シリコン基板1の面方向に沿ってエピタキシャル成長する。この $\text{GaN}$ 層3は、 $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ 層2の上部領域Bにだけ縦方向に転位が生じ、シリコン基板1の露出領域Aでは、横方向のエピタキシ

ナル成長であるために、転位は生じない。シリコン基板 1 の露出領域 A の面積を  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層 2 の上部領域 B の面積に比べて大きくすることで、広い面積に渡って結晶性の良好な GaN 層 3 を形成することができる。また、シリコン基板 1 とその上の GaN は化学的に結合していないために、GaN 層 3 のそり、応力歪みを極めて大きく減少させることができる。

【0017】尚、上記実施例において、ストライプ状又は格子状に形成されたシリコン基板 1 の露出領域 A の幅  $a$  を約  $5\mu\text{m}$  としたが、露出領域 A の幅  $a$  が  $10\mu\text{m}$  を超えると横方向の成長に長時間必要となり、シリコン基板 1 の露出領域 A の幅  $a$  が  $1\mu\text{m}$  未満になると、良好な GaN 膜の形成が困難となるので、望ましくは  $1\sim 10\mu\text{m}$  の範囲が良い。また、 $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層 2 の上部領域 B の幅  $b$  を  $5\mu\text{m}$  としたが、 $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層 2 の上部領域 B の幅  $b$  が  $10\mu\text{m}$  を超えると転位発生の確率が増大し、上部領域 B の幅  $b$  が  $1\mu\text{m}$  未満になると横方向の成長のための核形成が良好でできず、したがって、結晶性の良い横方向のエピタキシャル成長が困難となる。よって、望ましくは  $1\sim 10\mu\text{m}$  の範囲が良い。また、層 3 の結晶性の観点から、シリコン基板 1 の露出領域 A の幅  $a$  の  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層 2 の上部領域 B の幅  $b$  に対する割合  $a/b$  は  $1\sim 10$  が望ましい。

【0018】尚、上記実施例では、シリコン基板を用いたが、他の導電性基板、サファイア基板、炭化珪素等を用いることができる。導電性基板を用いた場合には、基板の裏面と基板上に形成された素子層の最上層とに電極を形成して、基板面に垂直に電流を流すことができ、発光ダイオード、レーザ等における電流供給効率が向上する。本実施例では、層 2 の組成を  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  としたが、任意組成比の一般式  $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_{1-x-y}\text{N}$  ( $0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1, 0\leq x+y\leq 1$ ) の窒化ガリウム系化合物半導体を用いることができる。シリコン基板 1 上にエピタキシャル成長させるには、 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$  ( $0<x\leq 1$ ) ( $\text{AlN}$  を含む) が望ましい。また、層 3 は、任意組成比の一般式  $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_{1-x-y}\text{N}$  ( $0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1, 0\leq x+y\leq 1$ ) の窒化ガリウム系化合物半導体を用いることができ、層 2 と同一組成比であっても、異なる組成比であっても良いが、基板に対してエピタキシャル成長しない組成比とする必要がある。又、本実施例では、層 2 の膜厚を約  $1000\text{\AA}$  としたが、層 2 は厚いとクラックが多くなり、薄いと層 2 を核として層 3 が成長しない。よって、層 2 の厚さは、 $500\text{\AA}\sim 2000\text{\AA}$  が望ましい。

【0019】(第 2 実施例) 上述の第 1 実施例では、第 1 の窒化ガリウム系化合物半導体として、 $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層 2 を 1 層だけ設けられている。本実施例では、第 1 の窒化ガリウム系化合物半導体として、 $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層 2 1 とその上の GaN 層 2 2 の 2 層で形成したことを特徴とする。

【0020】図 2 は、本発明の第 2 実施例に係わる窒化

ガリウム系化合物半導体の断面構成を示した模式図である。シリコン基板 1 の上には膜厚約  $1000\text{\AA}$  の  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層 2 1 が形成され、この層 2 1 上に、膜厚約  $1000\text{\AA}$  の GaN 層 2 2 が形成されている。層 2 1 と層 2 2 とで第 1 の窒化ガリウム系化合物半導体が構成される。これらの層 2 1 と層 2 2 層は、第 1 実施例と同様にストライプ状又は格子状に形成されている。層 2 2 及びシリコン基板 1 の露出領域 A 上には、膜厚約  $10\mu\text{m}$  の GaN 層 3 が形成されている。

【0021】この第 2 実施例の窒化ガリウム系化合物半導体は、第 1 実施例において、層 2 1、層 2 2 をシリコン基板 1 上に一様に形成した後、所定パターンの  $\text{SiO}_2$  層をマスクにして、層 2 1、層 2 2 をドライエッチングで図 1 (b) 又は (c) に示すように、ストライプ状又は格子状にする。その後の GaN 層 3 の形成は第 1 実施例と同一である。

【0022】膜厚約  $10\mu\text{m}$  の GaN 層 3 の成長過程は以下の通りである。GaN は、GaN 層 2 2 の上部領域 B の GaN を核として、面に垂直方向に成長する。そして、シリコン基板 1 の露出領域 A では、層 2 2 の露出領域 B 上に成長した GaN を核として、GaN が横方向にエピタキシャル成長する。このようにして、本実施例では、GaN が GaN を核として縦方向にも横方向にもエピタキシャル成長するので、第 1 実施例よりも、さらに、結晶性の高い GaN が得られる。

【0023】尚、本実施例において、層 2 2 と層 3 とを GaN としたが、層 2 2 と層 3 とを同一組成比の一般式  $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_{1-x-y}\text{N}$  ( $0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1, 0\leq x+y\leq 1$ ) の窒化ガリウム系化合物半導体としても良い。但し、層 2 は基板に対してエピタキシャル成長しない組成比とする必要がある。基板にシリコンを用いた場合には、Al が含まれない窒化ガリウム系化合物半導体を用いるのが良い。勿論、層 2 2 と第 2 の層 3 との組成比を変化させても良い。

【0024】上記の全実施例において、シリコン基板 1 又は、シリコン基板 1 から層 2 又は層 2 2 までの部分 C を研磨又はエッチングにより除去することにより、無転位の GaN 基板を得ることができる。上記の全実施例において、層 3 に GaN を用いたが、任意組成比の InGaIn を用いても良い。また、層 3 の上に、他の材料の半導体層を形成しても良い。特に、窒化ガリウム系化合物半導体をさらに成長させることで、発光ダイオード、レーザ等の特性の良好な素子を得ることができる。また、上記の全実施例において、基板 1 と層 2、又は層 2 2 の間に、任意組成比の AlGaIn のバッファ層や AlGaInN のバッファ層を設けても良い。このバッファ層は層 2、層 2 2 の単結晶成長温度よりも低温で形成されるアモルファス状又は微結晶の混在したアモルファス等の結晶構造をしたものである。

【0025】素子層として SQW 又は MQW 等の量子構

造を有した発光ダイオード、レーザを形成することができる。上記の全実施例において、MOVPE 法は常圧雰囲気中で行われたが、減圧成長下で行っても良い。また、常圧、減圧の組み合わせで行なっても良い。本発明で得られたGaN 系化合物半導体は、LEDやLDの発光素子に利用可能であると共に受光素子及び電子デバイスにも利用することができる。

【0026】尚、本件出願には、基板上に第1の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、その後、その第1の窒化ガリウム系化合物半導体を、基板の露出部が散在するように、点状、ストライプ状又は格子状等の島状にエッチングし、その後、島状態の第1の窒化ガリウム系化合物半導体を核として成長するが、基板の露出部を核としてはエピタキシャル成長しない第2の窒化ガリウム系化合物半導体を成長させ、基板の露出面上は横方向成長により形成することを特徴とする窒化ガリウム系化合物

半導体の製造方法も開示されている。

【図面の簡単な説明】

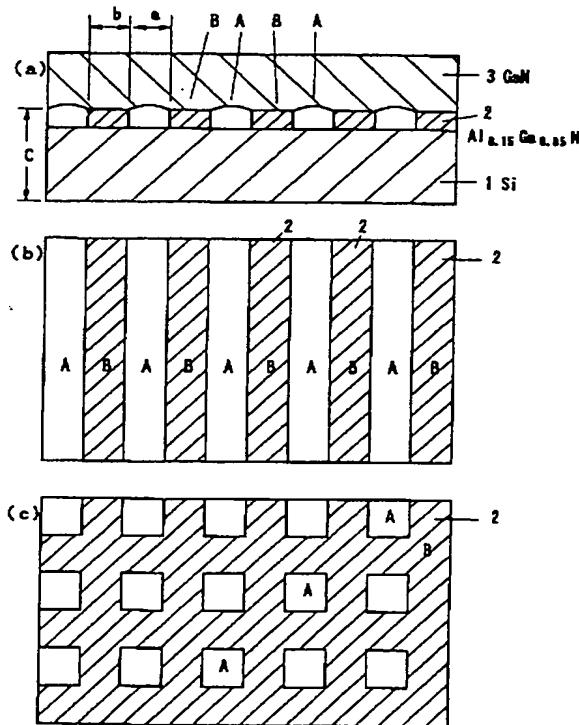
【図1】本発明の具体的な第1実施例に係わる窒化ガリウム系化合物半導体の構造を示した模式的断面図。

【図2】本発明の具体的な第2実施例に係わる窒化ガリウム系化合物半導体の構造を示した模式的断面図。

【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 2  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層（第1の窒化ガリウム系化合物半導体）
- 3 GaN 層（第2の窒化ガリウム系化合物半導体）
- 21  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  層（第1の窒化ガリウム系化合物半導体）
- 22 GaN 層（第1の窒化ガリウム系化合物半導体）

【図1】



【図2】

